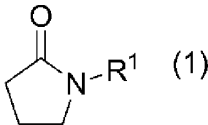


請求の範囲

- [請求項1] (A) 窒素原子に水素原子が直接結合していないN－置換アミド化合物、及び(B) 第四級フッ化アルキルアンモニウム又はその水和物、を含有する分解洗浄組成物の製造方法であって、前記(A)及び(B)を不活性ガス雰囲気下で混合する調製工程を有する、分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項2] 前記分解洗浄組成物が(C) エーテル化合物をさらに含有し、前記(A)～(C)を不活性ガス雰囲気下で混合する調製工程を有する、請求項1に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項3] 前記調製工程における前記不活性ガスが窒素ガスである、請求項1又は2に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項4] 前記調製工程の後、調製した前記分解洗浄組成物を不活性ガス雰囲気下で容器に封入する封入工程を有する、請求項1～3のいずれか一項に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項5] 前記封入工程における前記不活性ガスが窒素ガスである、請求項4に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項6] 前記(A) N－置換アミド化合物が式(1)：
- [化1]
- 
O=C1CCCC1N(R¹) (1)
- (式(1)において、R¹は炭素原子数1～4のアルキル基を表す。)
- で表される2－ピロリドン誘導体化合物である、請求項1～5のいずれか一項に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項7] 前記(A) N－置換アミド化合物が、式(1)においてR¹がメチル基又はエチル基である2－ピロリドン誘導体化合物である、請求項6に記載の分解洗浄組成物の製造方法。

- [請求項8] 前記 (C) エーテル化合物が、式 (2) :
- $$R^2O(C_nH_{2n}O)_xR^3 \quad (2)$$
- (式 (2) において、 R^2 及び R^3 はそれぞれ独立してメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、 n -ブチル基、イソブチル基、 sec -ブチル基、及び t -ブチル基からなる群より選択されるアルキル基を表し、 n は 2 又は 3 であり、 x は 1 ~ 4 の整数である。) で表されるグリコールのジアルキルエーテルを含む、請求項 2 に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項9] 前記グリコールのジアルキルエーテルが、ジプロピレングリコールジメチルエーテルである、請求項 8 に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項10] 前記 (C) エーテル化合物が、式 (3) :
- $$R^4OR^5 \quad (3)$$
- (式中、 R^4 及び R^5 はそれぞれ独立して炭素原子数 4 ~ 8 のアルキル基を表す。) で表されるジアルキルエーテルを含む、請求項 2、8 又は 9 のいずれか一項に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項11] 前記ジアルキルエーテルが、ジブチルエーテルである、請求項 10 に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項12] 前記 (B) 第四級フッ化アルキルアンモニウムが、 $R^6R^7R^8R^9N^+F^-$ で表されるフッ化テトラアルキルアンモニウムであり、 $R^6 \sim R^9$ がそれぞれ独立してメチル基、エチル基、 n -プロピル基、イソプロピル基、及び n -ブチル基からなる群より選択されるアルキル基である、請求項 1 ~ 11 のいずれか一項に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項13] 前記分解洗浄組成物が、接着性ポリマーの分解洗浄組成物である、請求項 1 ~ 12 のいずれか一項に記載の分解洗浄組成物の製造方法。
- [請求項14] 前記接着性ポリマーがポリオルガノシロキサン化合物である、請求

項 1 3 に記載の分解洗浄組成物の製造方法。